

钛靶材（纯钛/钛合金） 钛靶材: 98*45/95*40/128*45/100*40

产品名称	钛靶材（纯钛/钛合金） 钛靶材: 98*45/95*40/128*45/100*40
公司名称	宝鸡宇铭达金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新四路9号院8幢3单元号2204室（注册地址）
联系电话	0917-3217876 18292732691

产品详情

钛靶材是一种主要用于物理气相沉积（PVD）技术的特殊材料，溅射镀膜是指在真空条件下，利用获得功能的粒子（如氩离子）轰击靶材料表面，使靶材表面原子获得足够的能量而逃逸的过程称为溅射。适合于平面镀，例如：手机后壳，边框，板材等。

钛靶材以纯钛或钛合金为主要成分，经过精细制造而成。

高致密

熔炼设备技术性改造靶材致密度提升至95-99%

高纯度

特质原材料杂质含量低纯度提升至99.99%min

高精度

精密CNC机加中心公差±0.1mm表面粗糙度32Ra

钛靶材是通过真空熔炼-熔模铸造工艺制成的高纯钛或钛合金板坯材料。显著的特性是高纯度和优良的致密性。优质的钛靶材的致密度可以达到99.5%以上，且杂质元素极低，如Fe、Si、O、N、H等元素含量均小于100ppm。

此外，钛靶材还具有卓越的均匀性。在制备过程中，采用了三次熔炼和热处理，有效改善了钛靶材的组织均匀性。

钛靶材主要用途：

激光溅射：

制备机械部件的表面硬化层,提高抗磨性。

制备生物医用钛合金材料的表面涂层,提高生物相容性。

电弧蒸发：

制备太阳能电池的前电极透明导电膜。

制备复合材料的钛基增强层。

三、钛靶材的制备方法

冶金法

原理:采用真空电弧冶炼等技术熔炼高纯钛,然后经过多次熔炼淬火、冷轧或锻造等处理,制成钛靶材。

工艺流程:选料 熔炼 淬火锻造 机械加工 检测

优点:钛靶材致密度高,纯度高,均匀性好。

缺点:工艺复杂,能耗高,成本较高。

纯度

高纯度钛靶材(如99.99%)制备的膜层纯度高,性能好。但靶材耗损快,增加运行成本。低纯度钛靶材虽具有成本优势,但沉积膜的杂质含量高,影响膜层性能。

密度

致密度高的钛靶材膜层致密性好,附着力强。但密度过高也会使膜内应力增大。适中密度的钛靶材能获得性能均衡的膜层。

表面粗糙度

光亮平整的钛靶材可沉积表面质量更好的膜层。但过度抛光也会导致粒子脱落问题。适度的表面粗糙度有助改善薄膜的附着力。

